## 賛助会員の活動紹介

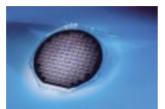
# オクメティック株式会社(Okmetic Oyj)

〒105-0014 東京都港区芝3-16-12 サンライズ三田 8 階 TEL 03-3789-1400 FAX 03-3789-1402

## 1.オクメティック株式会社の事業概要

オクメティック社は、高性能MEMSセンサ用シリ コンウェーハを製造するフィンランド在の世界有数 のメーカーで、1980年後半から20年以上にわたり 世界のMEMS市場および日本での事業活動を行っ ている会社です。オクメティック社は現在、グロー

バルな顧客ベースと販 売網を持ち、フィンラ ンド及び米国の自社製 造工場での製造に加 え、日本及び中国にお いて契約メーカーによ る製造を行っていま す。東京においては、 日本のお客さまを対象 としたサービスと技術 サポートを提供してお



オクメティックのソリューションは 100~200mm**の**SOI製品をプロセス 済み構造で提供しています。

り、日本国内で高まるMEMSウェーハへの需要にお 応えする体制を備えています。

## 2 . MEMSセンサ製造向 主要財務数値 けに設計された製品

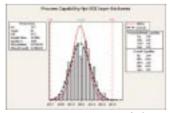
シリコンウェーハのメーカ -として洗練度の高い基材 を開発することにより、コ

(2007年1月1日~12月31日、単位:1,000ユーロ)		
	売上高	64,652
	営業利益	7,121
	利益率(%)	11
	年度末従業員数	357

スト削減と効率的なマイクロシステムの構築に貢献 しています。その中でもOkmetic BSOI (Boned SOI) 製品シリーズは、もっとも厳しいお客さまの要件にもお応えすることができる先進のSOI製品です。 これら製品シリーズの使用により、小型デバイスの 開発が可能となると同時に設計の自由度と生産性 を高めることができます。オクメティック社は100~200mmの全サイズのウェーハを提供しています。

また、Okmetic BSOIウェーハは、プロセス全体の コストを改善し、パフォーマンスを高めます。DRIE などの先端製造プロ

セスと併せ、Okmetic BSOIウェーハは新た な革新の機会をもた らすと同時に優れた 設計を可能にします。 さらにOkmetic 0.3-SOIウェー八において は、もっとも要求の 厳しい設計に対して



150mmSOIウェーハのデバイス 層厚の分布(9ポイント計測)

もデバイス層厚均一性がより改善され、デバイスの パフォーマンスをさらに高めます。

オクメティックC-SOI(キャビティSOI)は、エッ チング処理済みキャビティ構造を形成した接合ウェ ーハです。シリコン薄隔膜下に形成されたキャビテ ィは、一歩進んだ設計を可能にします。当社は、 お客さまのデバイス設計に最適化させたC-SOIソリ ューションをご提供いたします。

#### キャピティSOIの利点

- 1. エレメント設計の自由度が向上
- 2. 単純化された製造プロセス
- 3. 電気的・機械的特性の改善
- 4. ICとMEMSのプロセス統合が可能
- 5. 歩留りおよび原材料の責任は原材料供給業者に Okmetic G-SOIウェーハは、CMOS-MEMSの統合 を全面的にサポートします。ゲッタリング性能が強 化され、不純物ゲッタリングを効果的に行うこと によって、CMOSプロセスの最大の生産能力と設計 の自由度を保証します。

#### G-SOIの利点

- 1. 実績が証明する高いゲッタリング性能
- 2.標準BSOIウェーハより優れたGOI(ゲート酸 化膜信頼性)
- 3. 厚いSOIのCMOS処理に対応
- 4. アクティブ層の均一性またはBSOIの他の特性 に影響を与えない

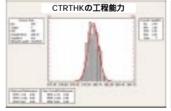
#### エピタキシャル・ウェーハ

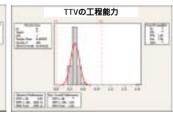
オクメティックのエピタキシャル・ウェーハは、層 の均一性と表面の品質に優れ、理想的なエピタキ シャル厚を有します。シリコンの異方性ウェットエ ッチングにおいて、オクメティックのエピタキシャル 層は、電気化学エッチング(N/Pインタフェース) および化学エッチング(ストレスフリー・ゲルマニウ ム (Ge) 同時ドープ P++) の両方のプロセスにおい て、エッチストップとして使用できます。

## 両面鏡面加工ウェーハと片面鏡面加工ウェーハ

Okmetic SSP(片面鏡面加工)ウェーハおよびDSP (両面鏡面加工)ウェーハは、結晶方位からのズレ を抑える卓越したシリコン加工の正確性と、MEMS に対し最適化された結晶品質を有します。さらに、 弊社のDSPウェーハは平坦性にすぐれ、厚さの種類 が豊富であるため、精密なバルクマイクロマシン加 工と両面リソグラフィが可能になります。

DSPウェーハは、ウェーハレベルのパッケージングで キャップウェーハとして広く使用されています。





### MEMS用シリコンウェーハによるパフォーマンス向上

お客さまの業界における将来のニーズと原材料 ソリューションの調査・分析を行い、それに基づ いて事業を展開しているオクメティックは、急速な 成長と進化を続けるMEMS市場で、もっとも種類 豊富な製品ラインにより、 シリコン・ソリューショ ンを提供しています。

詳しい情報は、当社にお問い合わせ頂くか又は ウェブサイトwww.okmetic.comをご覧下さい。

## 発 行 財団法人マイクロマシンセンター

発行人 青柳 桂一

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67 MBR99ビル6階 TEL.03-5835-1870 FAX.03-5835-1873

wwwホームページ:http://www.mmc.or.jp/